

NMFS 2022 ハンズオンワークショップ プログラム案 2022.8.19 現在

9月8日(木) Hands-on Workshop -Basic- 場所：東北大学西澤潤一記念研究センター

コース		A	B	C	D	E	F	G	H
メーカー		ハイデルベルグ・インストルメンツ	ハイデルベルグ・インストルメンツ	GenISys	エリオニクス	アメテック	ミカサ	SIJテクノロジー	パーク・システムズ・ジャパン
装置・ソフトウェア		DWL2000	MLA150	BEAMER	ELS-G125S ELS-7500X	Zygo Nexview	リアルタイム膜厚測定機能付コーター (持ち込み)	サブフェムトインクジェット	AFM NX20
内容		DWL2000：グレースケール露光デモ	MLA150：マスクレス露光アライメント露光実演、フィールドアライメント機能等	レーザ描画 DWL2000向け：Diffractive Optical Element(DOE)、マイクロレンズアレイパターン等のグレースケール露光データ補正 電子線描画 ELS-G125S向け：近接効果補正、フィールドつなぎ改善、ディスク形状補正など	ELS-G125S(130kV)とELS-7500X(50kV)を用いたリフトオフ向けLine and Spaceパターンの描画と比較 データ準備 (スケジュール組立など)、描画、現像、SEM(ELS)によるパターン確認	フレネルレンズ (DWL2000グレースケール露光+エッチバック) など各種サンプル形状の精密測定、測定データ処理	レジスト (とくにグレースケール露光用の10μm超の厚膜) の膜厚制御	フレキシブル基板への10μm線幅パターンの描画 (銀インク利用)	表面形状測定とケルビンプローブフォース顕微鏡(KPFM)による表面ポテンシャル測定
場所		2F CR	2F CR	会議室	2F CR	2F CR	2F CR	3F 実験室	1F CR
Session 1	10:00-12:00	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名
Lunch	12:00-13:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Session 2	13:00-15:00	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名
Session 3	15:00-17:00	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名	5名

基板：20mm角 Si x 6枚
レジスト：ZEP520A

9月9日(金) Hands-on Workshop -Advanced- 場所：東北大学西澤潤一記念研究センター

コース		A	B
メーカー		ハイデルベルグ・インストルメンツ	エリオニクス
		GenISys	GenISys
		ミカサ	ミカサ
		パーク・システムズ・ジャパン	パーク・システムズ・ジャパン
		アメテック	
内容		グレースケール露光と評価パターン：DOE、マイクロレンズアレイ データ：BEAMER補正(8日に用意) レジスト基板：ミカサコータ利用(8日に用意) 描画：DWL2000 形状測定：AFM NX20、Zygo Nexview	パターン：Line and Space(近接効果補正確認)、コーナー強調、導波路(エッジラフネス、フィールドつなぎ確認) データ：BEAMER補正(8日に用意) レジスト基板：ミカサコータ利用(8日に用意) 描画：ELS-G125S 形状測定：SEM(ELS-G125S)、AFM NX20
場所		2F CR	2F CR
AM	10:00-12:00	5名程度	5名程度
Lunch	12:00-13:00	↓	↓
PM	13:00-17:00	↓	↓

基板：20mm角 Si x 2,3枚
レジスト：ZEP520A
SEM観察後、AFM観察予定